

強的秩序とその操作に関わる 第10回研究会の開催案内



日時：2020年1月11日(土) 8:55～17:00

場所：東京大学（会場：工学部2号館246講義室）

会費：1,000円（一般、学生）

招待講演

「複合アニオン化合物薄膜の合成と新奇物性」

長谷川 哲也（東京大学理学系研究科化学専攻）

「半導体における強磁性秩序の発現と制御」

田中 雅明（東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻）

「分極性ペロブスカイトの材料設計と新機能開拓」

野口 祐二（東京大学工学系研究科応用化学専攻）

一般講演：予定 12件（発表12分、質疑3分、合計15分）

ポスター発表（発表者10名以上の場合ポスター賞あり）

概要(12/20 ㊦)：<http://annex.jsap.or.jp/ferroic/>

送付先：大矢忍 (東大) ferroic@cryst.t.u-tokyo.ac.jp

懇談会：2020年1月11日(土) 18:00頃開始予定

(場所：本郷キャンパス内 [Matsumoto](#) 予定)

主催：公益社団法人応用物理学会 強的秩序とその操作に関わる研究グループ

共催：東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所

：東京大学 スピントロニクス学術連携研究教育センター (CSRN-Tokyo)

：スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク (Spin-RNJ)

後援：公益社団法人応用物理学会東北支部

公益社団法人応用物理学会スピントロニクス研究会

強誘電体応用会議

協賛企業（五十音順）

ULVAC
アルバックテクノ株式会社

 **田中貴金属工業株式会社**

K & R Creation Co., Ltd.

 High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO., LTD.
株式会社 高純度化学研究所

 **TOSHIMA** 株式会社 豊島製作所

 レーザとレーザ応用システムの総合メーカー
ネオアーク株式会社

 株式会社 **富士交易**

 **MA-tek** 日本マーテック株式会社